

Министерство образования Российской Федерации  
Омский государственный университет

**Фотолитографический метод создания  
тонкопленочных ВТСП структур**

Лабораторный практикум  
(для студентов физического факультета)  
специальность 010400 «Физика»

УДК 538.945  
Ф81

*Рекомендован к изданию учебно-методическим советом ОмГУ.  
Протокол № 1 от 28 апреля 2004 г.*

**Ф81 Фотолитографический метод создания тонкопленочных ВТСП структур:** Лабораторный практикум (для студентов физического факультета) / Сост.: С.А. Сычев, Г.М. Серопян, И.С. Позыгун, В.В. Семочкин. – Омск: Омск. гос. ун-т, 2004. – 27 с.

Материал соответствует Государственному образовательному стандарту по специальности 010400 «Физика». Даются представления о фотолитографическом методе создания тонкопленочных структур с использованием метода сухого травления и, в частности, микро-структур из тонких ВТСП пленок для изготовления элементов сверх-проводящей криоэлектроники.

Может быть использован студентами других специальностей.

**УДК 538.945**

Издание  
ОмГУ

Омск  
2004

© Омский госуниверситет, 2004

*Учебно-практическое издание*

*Составители*

*С.А. Сычев, Г.М. Серопян, И.С. Позыгун, В.В. Семочкин*

ФОТОЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД СОЗДАНИЯ  
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ВТСП СТРУКТУР

Лабораторный практикум  
(для студентов физического факультета)

специальность 010400 «Физика»

Технический редактор *М.В. Быкова*

Редактор *Л.Ф. Платоненко*

---

Подписано в печать 21.05.04. Формат бумаги 60х84 1/16.  
Печ. л. 1,7. Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 50 экз. Заказ 314.

---

*Издательско-полиграфический отдел ОмГУ  
644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55а, госуниверситет*